# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-251021

(43)Date of publication of application: 22.09.1998

(51)Int.Cl.

CO1G 23/04 CO1G 23/07

(21)Application number: 09-054986 (22)Date of filing:

10.03.1997

(71)Applicant : SHOWA DENKO KK (72)Inventor: TANAKA ATSUSHI

> ARAI SHOICHI UEYOSHI YOSHINORI

# (54) SUPERFINE TITANIUM OXIDE POWDER SMALL IN CHLORINE CONTENT AND IT'S PRODUCTION (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a superfine titanium oxide powder small in chlorine content and suitable as a producing raw material of a dielectric such as BaTiO3.

SOLUTION: This superfine titanium oxide powder is produced by a vapor phase method and has X lower than a value expressed by an equation, X=35E0.02 lpha , when the specific surface area of powder measured by BET method is expressed by  $\alpha$  (m2/g) and the chlorine content is expressed by X(ppm). The producing method of the titanium oxide powder is by oxidizing titanium tetrachloride with oxygen, steam or the gaseous mixture at a high temp, to produce a crude titanium oxide powder and dechlorinating the powder while rolling in a cylindrical rotary heating furnace preferably with steam blown by controlling the temp. of the max. heated area of the powder to 150-650° C.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

## (11)特許出顧公開番号

# 特開平10-251021

(43)公開日 平成10年(1998) 9月22日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup> C01G 23/04

23/07

FΙ

C01G 23/04

R

23/07

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出廣番号 (22)出願日

特脳平9-54986

平成9年(1997)3月10日

識別記号

(71) 出頭人 000002004

昭和爾丁株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

(72) 発明者 田中 淳

富山県富山市西宮3 昭和タイタニウム株 式会社内

(72)発明者 新井 正一

富山県富山市西宮3 昭和タイタニウム株

式会补内

(72)発明者 植吉 義範

宮山県富山市西宮3 昭和タイタニウム株 式会补内

(74)代理人 弁理士 矢口 平

#### (54) 【発明の名称】 塩素含有量の少ない微粒子酸化チタン粉末及びその製造法

#### (57)【要約】

「課題】 BaTiO。等の誘雷体の製造原料として好 適な塩素含有量の少ない微粒子酸化チタン粉末を提供す ること。

【解決手段】 気相法による微粒子酸化チタン粉末であ ってBET法で測定した粉末の比表面積を $\alpha$  (m / g)、塩素含有量をX(ppm)とした場合、そのXが X=35E0.  $02\alpha$ なる関係式で示される数値より低 いことを特徴とする。酸化チタン粉末の製造法の発明 は 四塩化チタンを酸素又は水蒸気、或いはこれらの混 合気体を用いて高温酸化することにより粗酸化チタン粉 末を製造する第1工程と、該粉末を円筒形回転式加熱炉 中で好ましくは水蒸気を吹込み、転動させながら脱塩素 を行なう第2工程とからなる。

## 【特許請求の範囲】

1 【請求項1】 BET法で測定した粉末の比表面積をα (m<sup>2</sup>/g)、塩素含有量をX(ppm)とした場合、

その塩素含有量 X が X = 3 5 E 0、0 2 α なる関係式で 示される数値より低いことを特徴とする気相法によって 得られた塩素含有量の少ない微粒子酸化チタン粉末。

【請求項2】 ペロブスカイト化合物製造用の請求項1 記載の微粒子酸化チタン粉末。

【請求項3】 レーザー回折式粒度分布測定法で測定し た粒度分布曲線において、D。が2μm以下である請求 10 項1 又は2記載の微粒子酸化チタン粉末。

【請求項4】 粒度分布を表わすロジンーラムラー式に おけるn値が1.5以上である請求項1~3記載の微粒 子酸化チタン粉末。

【請求項5】 四塩化チタンを酸素又は水蒸気、或いは これらの混合気体を用いて高温酸化することにより程酸 化チタン粉末を製造する第1工程と、該粉末を円筒形回 転式加熱炉中で転動させながら脱塩素を行なう第2工程 とからなる塩素含有量の少ない微粒子酸化チタン粉末の 製造法。

【請求項6】 脱塩素を行なう第2工程において、粉末 に水蒸気を接触させることにより塩素含有量を請求項1 に記載の量とする請求項5記載の微粒子酸化チタン粉末 の製造法。

【請求項7】 第2工程における粉末の最高加熱帯の温 度が150℃以上650℃以下である請求項5又は6記 載の微粒子酸化チタン粉末の製造法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微粒子酸化チタン 30 (TiO。) 粉末及びその製造法に関し、さらに詳しく は四塩化チタンを原料とし、気相法により得られた微粒 子酸化チタン粉末であって、TiO。含有のペロブスカ イト化合物の製造に好適な塩素含有量の少ない微粒子酸 化チタン粉末及びその製造法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】酸化チタン粉末の製造法は、大別して四 塩化チタンを酸素或いは水蒸気と高温で反応させる気相 法と、四塩化チタンや硫酸チタンを加水分解する液相法 条件下で製造することができるという点は良いが、純度 が悪いこと、粒子が凝集し易いなどの欠点をもってい る。一方気相法による酸化チタン粉末はこれらの欠点は 少ないが、原料に四塩化チタンを使うため、粉末に塩素 が含まれてしまう欠点がある。特に粉末の粒子が細かく なる程塩素含有量が高くなることである。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】酸化チタン粉末は化粧 品、顔料、樹脂のフィラー、誘電体の原料などに使用さ れるが、最近は特に高性能の誘電体原料として注目され 50 末の比表面積と塩素含有量の相関関係において、従来の

ている。誘電体として、例えばBaTiO。は加熱下で 次の反応によって得られる。

BaCO<sub>2</sub> + TiO<sub>2</sub> → BaTiO<sub>2</sub> + C

Ωz BaTiO。の誘電体特性を高めるためには、先ずBa TiO、粒子を細かくすることが必要である。上記の反 広は周相反応であり、その際先ず高温でBaCO: が分 解してBaOが生成し、BaOがTiO2 粒子中を拡散 固溶してBaTiO。になると言われている。從ってB a TiO。粒子の大きさはTiO。粒子の大きさに支配 されることになる。

【0004】TiO。粒子に含まれる塩素は粒子のごく 表面層に吸着して存在しており、加熱中に生成したBa Oと反応してBaC1: が生成する。このBaC1: は 溶融してフラックスの作用をし、TiO2 粒子やBaT i O。粒子の凝集を引き起す。また溶融したフラックス は局在化し易く、その局在化した部分では凝集が多くな り、他の部分との間で品質にバラツキが生ずる。また粒 子が凝集するとBaTiO。粒子の結晶が成長して異常 20 粒子となり、BaTiO。の誘電特性を低下させること になる。さらにTiO2中の塩素の存在はBaOとTi O2 の原料組成比をくるわす原因となる。高性能の誘電 体においてはBaOとTiO。比は厳密に1:1に管理 する必要があるが、塩素が存在するとBaOの一部がB a C 1。となるため、組成比にずれが生じそれが品質低 下につながる。

【0005】本発明者は気相法による酸化チタン粉末に 含有する塩素の存在形態やその量について研究した結 果、次のようなことが判明した。塩素は酸化チタン粒子 の表面層に吸着して存在していること、従って粉末の比 表面積と塩素含有量との間には強い相関関係を有してい ることである。その相関関係図を図1に示す。図1は横 軸が粉末の比表面積α(m<sup>2</sup>/g)、縦軸が粉末の塩素 含有量X (ppm) で縦軸を対数目盛とするとほぼ直線 関係となる。

【0006】この塩素の脱離には一般に加熱法が行なわ れているが、あまり高い温度で加熱するとTiO:粒子 が成長するので加熱温度には制限があり、その温度範囲 において大気中で単に加熱しただけでは十分に塩素含有 がある。液相法による酸化チタン粉末は、比較的温和な 40 量を下げることはできず、そのため気相法 T i O 2 粉末 はある程度以上塩素を含んだまま使用されているのが現 状である。本発明は高純度にして粒子の凝集の少ない気 相法による微粒子酸化チタン粉末において、特に塩素の 含有量を低減させることを目的とする。さらに他の目的 は粒度が細かく、かつシャープな粒度分布の粉末を得る ことにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、酸化チタン 粒子の塩素含有量の低減について種々研究した結果、粉 ものよりも低い塩素含有量の微粒子の酸化チタン粉末を 得ることに成功したものである。即ち、本発明はBET 法で測定した粉末の比表面積をα(m²/g)、塩素含 有量をX(nnm)とした場合、その塩素含有量XがX =35Ε0.02αなる関係式で示される数値より低い ことを特徴とする気相法によって得られた塩素含有量の 少ない微粒子酸化チタン粉末である。

【0008】また、方法の発明は四塩化チタンを酸素又 は水蒸気、或いはこれらの混合気体を用いて高温酸化す ることにより解酸化チタン粉末を製造する第1工程と、 該粉末を円筒形回転式加熱炉中で転動させながら脱塩素 を行なう第2工程とからなる塩素含有量の少ない微粒子 酸化チタン粉末の製造法である。またこの製造法におけ る第2工程において、粉末に水蒸気を接触させることに より塩素含有量を前記の関係式で表わされるXの値より も低くすることを特徴とする微粒子酸化チタン粉末の製 造法である。

#### [00009]

【発明の実施の形態】四塩化チタンを原料とする気相法 によるTiO2 粉末の塩素含有量は図1に示すようにT 20 i O。粒子の大きさと相関関係があり、粒子が細かい程 塩素含有量は多くなる。そして従来のTiO2 粉末の塩 素含有量X (ppm) は図1の式X=35E0. 02α (図1の直線) で表わされる値より高いものであった \*

【0011】(3)式からx軸にlogD、y軸にlo g {log(100/R)} の目盛りをつけたロジンー ラムラー線図にそれらの関係をプロットすると直線とな 均一性が大となる。またD=DeのときR=36.8% であるから、図上でR=36.8%の粒子径を読めばD eが求められる。本発明の微粒子酸化チタン粉末は、粒 谷Dを上記の線図上にプロットした場合nの値が好まし くは1.5以上である。

【0012】次に製造法の発明について説明する。塩素 を低減させる前の組酸化チタン粉末の製造法 (第1工 程) は基本的には四塩化チタンを酸素又は水蒸気を用い て300~1600℃程度の高温で酸化反応させる公知 のいわゆる気相法である。通常TiCl, 1モルに対 し、O: (H,Oの場合はH2 O中のO2 換算)が1. 0~10モル程度用いられる。装置は一般に石英ガラス 製等の反応管が用いられる。この方法で得られた酸化チ タン粉末は通常0.1~2重量%程度の塩素を含んでお り、その量は粒度が細かいもの程多い。この粗酸化チタ ン粉末は脱塩素処理される。その方法は一般的には粉末 を大気中200~700℃程度で熱処理する方法であ る。温度の上限に限界があるのは粉末粒子の成長による 粒子の粗大化を防ぐためである。

【0013】しかし、本発明者の研究によると粗粉末を 50

\* (図1の白丸印)。ここでαはTiO2 粉末の比表面積 (m<sup>2</sup> / g) である。本発明の微粒子酸化チタン粉末は 前記式で表わされるXの値より低い塩素含有量である (図1の黒丸印)。 さらに好ましくはX=30E0.0 2 αで表わされる量よりも低い塩素含有量である。また 比表面積 $\alpha$ は好ましくは5 ( $m^2$  /g)以上である。 【0010】塩素含有量は上記のようにTiO2粒子が 細かい程多くなるが、誘電体原料として使用する場合、 その他一般に粒子は細かい程よく、好ましくはDss が2 μm以下、即ち粉末の90% (重量) 以上が0.2μm 以下である。また粉末中の粒子はできるだけ粒径がそろ っているのが良い。本発明はこれを粉末の粒度分布に関 する式として知られているロジンーラムラー(Rosi n-Rammler) 式を用い、その粒度の均一性を表 わす分布定数 (n) で規定することにする。ロジンーラ ムラー式(文献名:セラミック工学ハンドブック(社団 法人 日本セラミック協会編 1版、P. 596~59 8) 記載されている。)

R = 100 e x p (-bD')ここでRはD (粒径) より大きな粒子の百分率である。 b=1/De "とおくと(1)式は R=100exp { (D/De) " } (2) ここでDeは粒度特性数、nは分布定数と呼ばれる定数 である。(1) 式から (3)

単に加熱するだけでは粉末中の塩素含有量は十分に下が らず、そのため従来の市販品では図1に示すようにX= 35E0. 02 αの線よりも上であった。本発明の製造 る。その勾配nは粒度の均一性を表わし、nが大きい程 30 法はこの組酸化チタン粉末を第2工程において円筒形回 転式加熱炉中で転動させながら脱塩素化することを特徴 とする。転動させながら脱塩素化することにより静止状 能で脱塩素化するよりも脱塩素化率がかなり高まる。脱 塩素化装置は、例えばチタン製円筒回転炉が用いられ る。脱塩素の温度は高すぎると結晶成長を起こし、低い と脱塩素の効率が下がるので150~650℃の範囲が 好ましい。加熱時間は回転炉内の滞留時間で0.1~3 時間が適当である。

> 【0014】回転式加熱炉の雰囲気は大気中でもよく、 これによっても塩素含有量はかなり下がるが、塩素低減 の効果を高めるには水蒸気を吹込むのがよく、特に前記 の式X=35E0.02 αよりも低い塩素含有量とする 場合は加熱炉内に水蒸気を吹込み、TiO2とH2Oを 接触させる必要がある。空気と水蒸気の混合の場合は水 蒸気を0.1容量%以上含むことが好ましい。表面吸着 の填素との反応性は、酸素により水の方が高い。このた め、水蒸気を酸化チタン粉末粒子に接触させることによ り、効率的な脱塩素化が進むと考えられる。 [0015]

【実施例】以下実施例により具体的に説明するが、本発

明は実施例に限られるものではない。先ず粗酸化チタン を次の方法で製造した。

# (1) 粗酸化チタン [

ガス状四塩化チタン8. 9 Nm<sup>3</sup> / h r と、酸素 1 1. 3 Nm<sup>®</sup> /hrをそれぞれ1000℃まで予熱し、連続 的に石英ガラス製反応器に導入した。得られた反応混合 物を急速冷却後、テフロン製バグフィルターにて粉を補 集して、微粒子酸化チタンを30kg/hrで得た。こ の酸化チタンは、比表面積3.2 m2/g、ルチル化率 97%、残留塩素 0.1% (重量%、以下同じ) であっ た。

#### 【0016】(2)組酸化チタンII

ガス状四塩化チタン5. 9 Nm3 / h r と、酸素 5. 2 Nm<sup>3</sup> /hrおよび水蒸気7.9Nm<sup>3</sup> /hrの混合気 体をそれぞれ900℃まで予熱し、連続的に石英ガラス 製反応器に導入した。得られた反応混合物を急速冷却 後、テフロン製バグフィルターにて粉を補集して、微粒 子酸化チタンを20kg/hrで得た。この酸化チタン は、比表面積28m<sup>2</sup>/g、ルチル化率32%、残留塩 泰1.2%であった。

#### 【0017】(3) 粗酸化チタンIII

ガス状四塩化チタン5. 9 Nm<sup>3</sup> / h r と、酸素2. 2 Nm<sup>3</sup> /hrおよび水蒸気10.3Nm<sup>3</sup> /hrの混合 気体をそれぞれ900℃まで予熱し、連続的に石英ガラ ス製反応器に導入した。得られた反応混合物を急速冷却 後、テフロン製バグフィルターにて粉を補集して、徴粒 子酸化チタンを20kg/hrで得た。この酸化チタン は、比表面積101m<sup>2</sup> /g、ルチル化率15%、残留 塩素 2. 1% であった。

#### [0018] 実施例1

粗酸化チタン1を、チタン製外熱式回転炉(径200m m、長さ1500mm、回転速度3rpm) に、30k g/hrでフィードした。炉内には水蒸気を1.0Nm /hr導入した。炉内の最高温度帯域を600℃にし て粉末を炉内に1時間滞留させ脱塩素処理した。その結 果、比表面積は3.1m<sup>2</sup>/gでほぼ変りないが、残留 塩素は30ppmに低減していた。上記の比表面積αの 値3. 1 (m²/g)をX=35E0.02αに代入し てXを求めると40(ppm)となり、実施例1の酸化 チタンの塩素含有量は上記式で表わされる量よりも低く 40 なっている。この粉末のレーザー回折式粒度分布測定法 (測定手順は、下記) による粒度分布Dm (以下、単に D<sub>m</sub> と略す) は1. 5 μ m であり、R R - 線図 (ロジン - ラムラ一線図)におけるn値(以下、単に「n値」と 略す) は2.5であった。粒度分布測定手順は、酸化チ タン0.05gに純水5.0ccおよび10%ヘキサメ タリン酸ソーダ水溶液100μ1を加え、3分間超音波 照射 (46KHz、65W) する。このスラリーをレー ザー同折式粒度分布測定装置 ((株) 島津製作所製SA LD-2000J) にかけた。レーザー回折において得 50

られた3点データ、Ds 、Ds 、Ds をそれぞれロジン - ラムラー線図においてR=90%、R=50%、R= 10%としてプロットする。これらの点を通る直線を引 き、これからn値を求める。

#### 【0019】実施例2

粗酸化チタンIIを実施例1と同じ回転炉に20kg/h ェでフィードした。炉内の最高温度帯域を550℃とし た以外は実施例1と同様にして脱塩素処理した。その結 果、比表面積は27m2/gでほぼ変りないが、残留塩 素は100ppmに低減していた。X=35E0.02 αのαを27とするとXは121となり、粉末の実測の 塩素含有量は前記の式の値より低くなっている。またD ω は 0. 7 μ m で あ り、 n 値 は 3. 5 で あった。

### 【0020】実施例3

粗酸化チタンIII を実施例1と同じ回転炉に20kg/ h r でフィードした。炉内の最高温度帯域を350℃と した以外は実施例1と同様にして脱塩素処理した。その 結果、比表面積は99m²/gでほぼ変りないが、残留 塩素は2800ppmに低減していた。X=35E0.

20 02 α の α を 9 9 と する と X は 3 3 0 0 と な り 、 粉末 の 実測の塩素含有量は前記の式の値より低くなっている。 またD<sub>n</sub> は1. 3 μ m であり、n 値は2. 4 であった。 【0021】実施例4

粗酸化チタンIIを回転炉に水蒸気を導入せず、大気中と した以外は実施例2と同様にして脱塩素処理した。その 結果、比表面積は27m2/gでほぼ変りないが、残留 塩素は150ppmで、水蒸気を導入した実施例2に比 べやや高かった。これからX=35E0.02αに従っ てXを求めると121となり、実測値の方がわずか高 30 い。なお、Dm は0. 9 μmであり、n値は3. 1であ

#### 【0022】比較例1

粗酸化チタンIIの2kgを、チタン製バットに粉厚み3 0 mmにて敷き詰めた。これを電熱炉に入れ550℃、 3 h r で脱塩素したところ、比表面積は26 m²/g で、残留塩素は380ppmに低減していた。X=35 E 0. 0 2 α の α を 2 6 として X を求めると 1 1 5 とな る。従って残留塩素は前記式の値よりもかなり高い。ま . た、D<sub>n</sub> は1. 3 μ m であり、n 値は2. 8 であった。 [0023]

比較例2日本アエロジル社の超微粉酸化チタンP-25 を分析したところ、比表面積48m2/gで塩素を82 Ο p p m含有していた。 X = 35 E 0. 02 α から X を 求めると319となり、残留塩素は前記式の値よりも相 当高い。また、D∞ は3. 1 µ mであり、n値は1. 4 であった。

#### 【0024】比較例3

東邦チタニウム社製の高純度酸化チタンを分析したとこ ろ、比表面積は2.2m2/gで塩素を60ppm含有 していた。X=35E0.02αからXを求めると39

となり、残留塩素は前記式の値よりも高い。また、D<sub>2</sub>は3.2μmであり、n値は1.7であった。

[0025]

 \* 即ち粒度分布がシャープであり、かつ微緑な粒子とする ことが可能なので、上記化合物以外の種々用途にも好適 である。

【図面の簡単な説明】

【図1】酸化チタン粉末の粒径と塩素含有量の関係を示すグラフである。

【図1】

